局所領域の面内/垂直磁化成分同時測定 Kerr 効果測定装置の開発

小田切 雄介、柳沢 栄二、目黒 栄、斉藤 伸* (ネオアーク株式会社、*東北大学) MO Kerr effect sensing system for simultaneous detection of local magnetization components along perpendicular/ in-plane to the film plane

Y. Odagiri, E. Yanagisawa, S. Meguro, S. Saito* (Neoark Corporation, **Tohoku University)

はじめに 軟磁性ナノドットおよび細線は、現在精力的に研究が進められている MRAM¹⁾ やスピントロニクス素子に 代表される次世代磁気デバイスを構成する主要材料である。これらのデバイスは磁性材料の形状異方性を考慮して 設計がなされるが、成膜時の誘導磁気異方性や加工プロセスの不完全性等により、面内・垂直磁化過程に予期せぬ 磁気履歴が生じ所望の特性を導出できない場合があるため、簡便かつ高感度に面内/垂直方向の磁化成分を分離で きる局所磁気履歴曲線評価装置に対する需要が高まっていた。可視光レーザによる磁気光学効果を用いる測定は、 原理的には波長程度の空間分解能を実現できると考えられ、またその検出原理により試料の非破壊性、評価の簡便 性、高速性を併せ持つことから前記需要に相応するものである。我々はこれまで、レーザ特有の雑音に対する対策す なわち、発振モードの安定化およびコヒーレンシーの低下等を実現する装置設計指針ならびに極微量の磁気光学信 号を高感度・高速に検出する装置設計について確立してきたが、面内/垂直磁化成分を分離する評価技術について

は取り組んでいなかった。本講演では、顕微鏡対物レンズを用いて Kerr 効果検出の空 間高分解能化と検出高感度化とを両立した装置を用い、斜光入射磁気光学効果測定に 縦カー効果と極カー効果が重畳することを利用しながらこれらを分離して計測可能な磁 気履歴曲線評価装置 (u-MOKE, u-SMOKE) を開発したので報告する。

Fig.1 に今回検討した斜光入射光学系の対物レンズと試料周りの光軸の概



Fig. 1 Scematics of magnetization direction detection.

実験結果 Fig. 2 に本手法で計測した GdFeCo 薄膜の磁気履歴曲線を示す。垂直

略図を示す。同一入射面で正・逆両方向からレーザ光を入射させる場合、面内成分に起 因する磁気光学信号は逆相となる一方、垂直磁化成分に起因する信号は同相となる。し

たがってこれらの信号を加算/減算処理することにより、垂直方向および面内方向成分の

磁化成分に起因する信号が得られている一方で面内磁化成分の信号は検出されておらず、本試料が垂直磁化膜で あることがわかる。FeTaN 薄膜の磁気履歴曲線では(Fig. 3) 面内磁化成分に起因する信号のみが検出されており、 この試料が面内磁化膜であることがわかる。これらに対し Fig. 4 に示す FeCoTaZr 薄膜では、面内磁化成分の他に 垂直磁化成分も検出されており、本試料では成膜時に何らかの垂直磁気異方性が発現したことが示唆される。

本研究の一部は平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金を受けて実施された。 謝辞

参考文献 1) T. Nagai et al., IEEE Trans. Magn., 39, (2003). 2) S. Meguro et al., Ann. Conf. Magn. Soc. Jpn., 7aF-10 (2010).



磁気履歴曲線を同時に、かつ分離測定可能となる 1-2)。





Hysteresises for a FeTaN film **Fig. 4** Fig. 3 with applying field parallel to the film film with applying field parallel to the plane.

Hysteresises for a FeCoTaZr film plane.

測定原理

交番磁気力顕微鏡の高分解能化に向けた磁場中熱処理 による高感度 FeCoSiB 系非晶質ソフト磁性探針の開発

赤石悠輔, K. Srinivasa Rao, 江川元太, 吉村哲, 齊藤準

(秋田大学)

Development of high-sensitive amorphous FeCoSiB soft magnetic tip by magnetic field annealing

for high resolution alternating magnetic force microscopy

Y. Akaishi, K. Srinivasa Rao, G. Egawa, S. Yoshimura, H. Saito

(Akita Univ.)

はじめに 近年,磁気力顕微鏡においては高密度磁気記録媒体等の進展により空間分解能の向上が強く求 められている.我々は分解能の向上に有効となる試料表面近傍での磁場検出が可能な,交番磁気力顕微鏡 (Alternating Magnetic Force Microscope; A-MFM)を開発し,昨年,良好なソフト磁気特性と高い飽和磁化を有 する FeCoSiB 系非晶質ソフト磁性探針の先鋭化を図ることで,垂直磁気記録媒体の磁区観察において,5nm 以 下の分解能が安定して得られることを報告した¹⁾.ここで探針の先鋭化には,先鋭な Si 探針母材を回転させ ながら,スパッタリング法を用いて磁性膜を探針の側面方向から成膜することが有効であった.一方,FeCoSiB 系非晶質合金は Co 系非晶質合金と異なり,磁歪を組成調整によりゼロにできないので,ソフト磁気特性向上 の観点から歪取り熱処理が有効と考えられる.また熱処理中の磁場印加により誘導磁気異方性の付与が可能 であるので,探針先端の磁化状態を制御できる可能性がある.本研究では,FeCoSiB 系非晶質合金探針につい て磁場中熱処理を行い,磁場中熱処理の効果を A-MFM 観察により検討した結果を報告する.

方法 FeCoSiB 非晶質ソフト磁性探針を,先端がピラミッド形状のSi 探針にターゲット組成が Fe₅₆Co₂₄Si₁₀B₁₀ の磁性膜を種々の膜厚でスパッタリング法を用いて成膜した後に,磁場中熱処理を施して作製した.熱処理 温度は 150~250 ℃の範囲で変化させた.磁場は探針のピラミッド形状先端の長手方向(探針を磁気力顕微鏡 にセットしたときに観察面に垂直方向に対応)に印加し,その最大値は 2 kOe である. A-MFM は市販の走査 型プローブ顕微鏡(L-Trace II,日立ハイテクサイエンス製)に,小型フェライトコア(交流磁場源),PLL(周 波数復調器),ロックインアンプを加えて構成した.観察試料には CoCrPt-SiO2 垂直磁気記録媒体を用い,探 針試料間距離を 2~3 nm にして直流磁場観察を行った.探針に印加した交流磁場の周波数は 89 Hz とし,振幅 は 50~200 Oe の範囲で変化させた.

結果 磁場中熱処理を施した FeCoSiB 非晶質探針を用いて 500 kfci の磁気記録ビットを A-MFM 観察した. ここで磁場 中熱処理条件は、印加磁場2kOe,保持温度200℃,保持時間 2h である. Fig.1 に磁性膜厚が 15, 25, 30 nm, 交流磁場振幅 が 50,200 Oe のときの直流磁場像を一例として示す. これま で試作したソフト磁性探針(ゼロ磁歪のパーマロイ探針や CoZrNb 系非晶質探針)では磁性膜厚や交流磁場の増加に伴 い信号強度が増加するのに対して、磁場中冷却した FeCoSiB 非晶質探針では磁性膜厚が増加すると記録ビットが不鮮明 になり計測感度が減少していることがわかる.図で最も計測 感度が高い磁性膜厚 15nm では、図(a)に見るように 50 Oe に おいても記録ビットが観察できており, 観察に要する交流磁 場値を低減できることがわかる.これらの挙動の原因として, 磁性探針先端の磁性膜の磁化状態が磁場中熱処理や磁歪効 果による誘導磁気異方性の影響で変化していることを考え ている. 講演では, 空間分解能向上の可能性を探るために, さらに磁性膜厚の小さな探針を含めて,磁場中熱処理条件が 磁性探針の感度と分解能に及ぼす影響の詳細を報告すると ともに、低磁性膜厚で計測感度が向上した原因を考察する.



Fig. 1 A-MFM images measured by magnetic field annealed FeCoSiB tips with magnetic film thickness of 15, 25, 30 nm at AC magnetic field of 50 and 200 Oe, respectively.

参考文献 1) K. S. Rao 他, 第 39 回日本磁気学会学術講演概要集, 8pD-3 (2015).

超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微鏡による永久磁石の 破断面の磁気イメージング手法の開発

曹永澤,江川元太,吉村哲,齊藤準 (秋田大学)

Development of magnetic imaging for fractured surface of permanent magnets by alternating magnetic force microscopy with superparamagnetic tip

Y. Cao, G. Egawa, S. Yoshimura, H. Saito

(Akita Univ.)

はじめに現在,磁区観察に広く用いられている磁気力顕微鏡の観察対象である磁性材料については,従来の表面平滑な磁性薄膜の他に,近年,バルク材料である永久磁石において,機械研磨を施さずに粒界で破断させた面(破断面)での磁区観察が求められている.その背景として,希土類磁石の磁区観察において,機械研磨した面では,内部の結晶粒と比較して磁化反転が弱い磁場で起こるのに対して,破断面では磁化反転がバルク体と同等の磁場で起こることが,放射光を用いた走査型軟X線MCD顕微鏡の観察¹⁾により報告されていることがある.本発表では,永久磁石の破断面等の表面凹凸の大きな試料における磁区観察を,磁気力顕微鏡により実現することを目的として,我々が開発を進めている超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微鏡(Alternating Magnetic Force Microscopy; A-MFM)を用いて,フェライト磁石の破断面の観察を行った結果を報告する.

方法 A-MFM は機械的に励振させた磁性探針に対して, 交流磁場印加により探針磁化を周期的に変化させることで 発生する探針試料間の交番磁気力が誘起する探針振動の周 波数変調現象を利用して,探針振動信号を周波数復調後に ロックイン検出して試料からの直流磁場を計測する.

A-MFM では超常磁性探針を用いることで,計測磁場方向を 交流磁場の印加方向に一致させた直流磁場の計測を行うこ とができる.本研究では A-MFM を市販のプローブ顕微鏡 (日立ハイテクサイエンス製, L-trace II)の試料ステージの下に交流 電磁石を設置して構成し,交流磁場を試料ステージに垂直 方向に印加して,直上の超常磁性探針(Gd₂O₃-FeCo等を自 作)を励磁し,Srフェライト異方性焼結磁石(結晶粒径: 約 1µm,保磁力:約 3.0 kOe)の破断面を大気雰囲気中で観 察した.

結果 Fig.1 に消磁状態のc面(磁化方向が面に垂直)の破断面において超常磁性探針を用いた A-MFM により観察した, (a)表面形状像,計測磁場方向が紙面に垂直方向の(b)垂



Fig.1 (a) topographic image, (b) perpendicular magnetic field image, (c) polarity image of magnetic field for fractured surface of sintered Sr ferrite magnet. (d) and (e) are the line profile of (b) and (c), respectively.

直磁場像およびそのラインプロファイル[(d)], (c)磁場極性像およびそのラインプロファイル[(e)]を示す.表面の凹凸は約1.5 µm であり,通常の磁気力顕微鏡では磁区の識別が困難であったが, A-MFM では表面の結晶粒の形状を反映した 明瞭な磁区構造が垂直磁場像で観察され,磁場極性像では垂直磁場の上向き/下向き (表面磁極の極性)が明瞭に識別できる.これらのラインプロファイルに見るように,垂直磁場の強度がゼロになる垂直磁場の上向き/下向き の境界で,位相が180°変化しており,表面凹凸が大きいのにもかかわらず,磁区構造が明瞭に観察できるこ とがわかる.破断面で磁区観察ができるのは,超常磁性探針が磁場の計測方向である探針の真下からの垂直 磁場を主に捉えているためと推察される.講演では,試料からの直流磁場計測の詳細に加えて,試料の磁化 が交流磁場で可逆的に変化する箇所で発生する交番磁気力を利用した,試料からの交流磁場のイメージング 結果についても報告する.測定試料は日立金属(株)様からご提供いただきました.

参考文献 1) 中村哲也, 小谷佳範, 広沢哲, 第 39 回日本磁気学会学術講演概要集 10pA-1, 2015.

磁場分布のカラーイメージング用

磁気光学イメージングプレートの開発

長久保洋介, 劉琦, 婁庚健, 石橋隆幸 (長岡技科大) Development of MO imaging plate for colour imaging. Y. Nagakubo, Q. Liu, G. Lou, and T. Ishibashi (Nagaoka Univ. of Tech.)

1. はじめに

磁気光学イメージングプレートを用いた磁気光学イメージングは、磁場分布をリアルタイムで可視化可能な優れた磁気イメージング技術である.しかし、磁場分布は光の強度分布として計測されるため、画像を見ただけで磁場の方向およびその大きさを知ることは困難であった.そこで本研究では、磁場分布をカラーでイメージングすることにより、色によって磁場の値を識別する技術を開発した.本発表では、高濃度 Bi 置換磁性ガーネットを用いた磁気光学イメージングプレートの性能指数の評価と磁気光学イメージングの磁場分布のカラー表示およびその定量化について報告する.

2. 実験方法

Bi 置換 Nd 系磁性ガーネット膜は,有機金属分解法(MOD 法)を用いて作製した.ガラス基板上に下地層として Nd₂Bi₁Fe₄Ga₁O₁₂ (膜厚:90 nm)を作製し,その上に NdBi₂Fe₅O₁₂

(膜厚:470 nm)の薄膜を作製した^{1,2)}. NdBi₂Fe₅O₁₂薄膜は, 下地層と同様に,塗布から仮焼成までを5回繰り返した後に 本焼成(600-700℃, 3 hour)を行うプロセスを3回繰り返した. 最後に、反射膜として銀薄膜をガーネット膜の上に堆積させ た。カラーイメージングでは、5Wの自色パワーLEDと偏光 子および検光子(駿河精機:S342-D-550)を用いた.また,検 光子を透過した光のスペクトルを光学分光器(Ocean Optics:USB2000+)を用いて測定した.



Fig. 1 に本焼成温度の異なる試料の性能指数 $Q = \theta_{\kappa}$ ・ *T* [*deg*.] を波長に対してプロットしたグラフを Fig. 1 に示 す.ここで、 θ_{κ} は反射膜をつけた後のカー回転角、*T*は透過 率である.本焼成温度が 640~660℃の場合に 600 nm 付近 で高い性能指数が得られた.磁気イメージングプレートと 白色 LED 光源を用いて、市販のフェライト磁石の磁場分布 を計測した結果を Fig.2 に示す。あらかじめ磁場と色の関係 を校正しておいたカラーバー(Fig. 2)との比較により磁場の 大きさも識別できることがわかる。

参考文献

- 1) 劉琦他, 第39回日本磁気学会学術講演会, 08pB-2
- 2) G. Lou et al., J. Appl. Phys., 117, 17A749 (2015).



Fig. 1 Figure of merit of MO imaging plates using NdBiFeO films annealed at 600-700°C.



Fig. 2 An MO image of a ferrite magnet and colour bar indicating magnetic field.

走査型透過X線顕微鏡による永久磁石材料のXMCD顕微分光

上野哲朗^{1,2,3},橋本愛²,武市泰男²,小野寛太^{2,3} (¹物材機構,²KEK,³ESICMM)

XMCD micro-spectroscopy of a permanent magnet using a scanning transmission X-ray microscope Tetsuro Ueno^{1,2,3}, Ai Hashimoto², Yasuo Takeichi², and Kanta Ono^{2,3} (¹NIMS, ²KEK, ³ESICMM)

はじめに

永久磁石材料の開発、高機能化において磁気モーメントや希土類イオンの価数などの電子状態の情報は重要であると考えられる。しかしながら、永久磁石材料は Nd₂Fe₁₄B 磁石のように実用材料としては多結晶体であること、また Sm₂Fe₁₇N₃ のように粉末試料しか得られないということがある。そのため単結晶試料を用いた精密な電子状態評価実験が困難である。本研究では、微細加工法による単結晶試料の抽出と、集光した放射光 X 線を用いて局所的な X 線スペクトルが測定可能な装置である走査型透過 X 線顕微鏡 (STXM) を組み合わせて、実用永久磁石材料の電子状態評価を行った。

実験方法

試料には市販の1-5系サマリウムコバルト磁石を用いた。化学組成はSm_{0.5}Pr_{0.4}Gd_{0.1}Co₅であった。1000℃で 熱消磁した後、収束イオンビーム加工装置による微細加工によって単結晶試料を切り出した。XMCD 顕微分 光実験は高エネルギー加速器研究機構・放射光科学研究施設(PF) BL-13A に設置された走査型透過 X 線顕微 鏡(STXM) [1]を用いて行った。Sm、Pr、Gd の各 *M*_{4,5}吸収端、Co *L*_{2,3}吸収端において X 線エネルギーをスキ ャンしながら STXM 像を取得し、X 線吸収スペクトルおよび XMCD スペクトルを得た。

実験結果

Fig. 1 に円偏光 X 線を用いて Co L₃ 吸収端で測定した STXM 像を示す。迷路状磁区がコントラストとして現れることがわかる。

Fig. 2 に STXM 像の X 線エネルギースキャンにより取得した Sm $M_{4,5}$ XAS 及び XMCD スペクトルを示す。各 XAS スペクト ル (μ_{+} と μ_{-}) は STXM 像で逆向きに磁化しているピクセルでの 強度をエネルギー毎に積算することで得た。これらの差分から XMCD スペクトル (μ_{+} - μ_{-})を得た。XMCD スペクトルに磁気光 学総和則を適用して軌道磁気モーメント L とスピン磁気モーメ ント S の比を求めたところ L/S~2 となり、フント則から導かれ る 3 価 Sm イオン Sm³⁺の軌道・スピン比 L/S = 2 とほぼ一致す ることがわかった。 4 µm

Fig. 1. STXM image at the Co L_3 edge.



Fig. 2. Sm $M_{4,5}$ XAS (μ_+ and μ_-) and XMCD ($\mu_+-\mu_-$) spectra.

参考文献

[1] Y. Takeichi et al.: Rev. Sci. Instrum., 87, 013704 (2016).